

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 3 月 24 日 (24.03.2005)

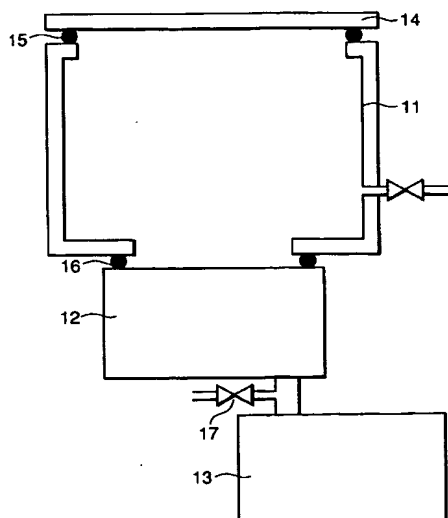
PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/025735 A1

- (51) 国際特許分類⁷: B01J 3/00, 3/02, H05B 33/10, 33/14, C23C 14/00, 14/24
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/012239
- (22) 国際出願日: 2004 年 8 月 19 日 (19.08.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-296439 2003 年 8 月 20 日 (20.08.2003) JP
- (71) 出願人 および
(72) 発明者: 大見 忠弘 (OHMI, Tadahiro) [JP/JP]; 〒9800813 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋 2 丁目 1-17-301 Miyagi (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 白井 泰雪 (SHIRAI, Yasuyuki) [JP/JP]. 森本 明大 (MORIMOTO, Akihiro) [JP/JP].
- (74) 代理人: 後藤 洋介, 外 (GOTO, Yosuke et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋 1 丁目 4 番 10 号 第三森ビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
— 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: VACUUM TREATMENT APPARATUS AND VAPOR DEPOSITION APPARATUS

(54) 発明の名称: 真空処理装置および蒸着装置



(57) Abstract: It has been found that an organic component is emitted from a member such as a crucible or a gasket constituting an apparatus for vacuum treatment and an element is contaminated with said organic component emitted, and, as a result, members of the apparatus for vacuum treatment are subjected to a treatment for reducing the emission of an organic component. For example, a crucible is made from a material having a reduced catalytic activity to a material for use in the vapor deposition in question and a gasket is used after a treatment for reducing the bleeding of an organic component or is made from a material containing a reduced amount of an organic component.

(57) 要約: 減圧処理装置を構成するつぼ、ガスケット等の各部材から有機物成分が放出され、当該放出された有機物成分によって素子が汚染されることを見出し、有機物成分の放出を軽減する処理を減圧処理装置の各部材に施す。例えば、つぼは蒸着材料に対して触媒性の低い材料によって形成し、ガスケットは有機物の溶出低減処理を施したものを使用するか、有機物の少ない材料のものを使用する。